

日時 2015年12月25日～27日  
 場所 東北大学未来情報産業研究館5F大会議室

プログラム \* 内容、時間、講師等は都合により変更する場合があります。ご了承ください。

日時	時間	分	担当	タイトル・内容
12月25日	13:00～15:00	120	大見(東北大学)	FFF(Fluctuation Free Facility)設計論 クリーンルームの基本的考え方から実際に使用されている技術、省エネ対策の事例、クリーンルームの維持管理手法等について
12月25日	15:15～17:15	120	白井(東北大) 今泉(東北大)	FFF設備実習 クリーンルームおよび機械室にて使用されている設備等について現地で実物を確認しながら理解を深める。クリーンルームはもとより普段は入室できないユーティリティゾーンや機械室にも入って頂きます。
12月26日	9:30～10:30	60	白井(東北大学)	固体表面への水分吸着・汚染 シリコン表面やステンレス等の固体表面に対して気相中に含まれる水分の吸着・汚染挙動および測定方法について
12月26日	10:40～12:10	90	若山(大成建設)	固体表面への有機物吸着・汚染(大気圧下) クリーンルーム等の大気圧下におけるシリコン表面への有機物汚染とその制御方法について
12月26日	13:00～14:30	90	白井(東北大学)	固体表面への有機物吸着・汚染(減圧下) 製造装置内等の減圧下におけるシリコン表面に対して有機物の吸着・汚染およびその対応策について
12月26日	14:40～17:10	150	白井(東北大学)	超高純度ガス供給技術 ガス供給技術の基本的考え方、ステンレスの表面研磨、不動態処理技術、流量制御器等のガス部品について
12月27日	9:30～12:00	150	横井(栗田工業)	超純水製造技術 超純水製造の基本から機能水(水素水、オゾン水等)の効果、使用済み薬液の回収技術まで
12月27日	13:00～15:00	120	稲葉(高砂熱学工業)	静電気障害とその対策 シリコンウェーハやガラス基板における静電気の基礎的考え方とその測定方法および対策技術について、豊富な事例を交えながら紹介
12月27日	15:15～17:15	120	大見(東北大学)	学問に基づいた本物のシリコン半導体技術 半導体技術の現状の課題とその解決方法および今後の方向性について最新の研究成果を含め紹介する